(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年2月17日(17.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/015699 A1

(51) 国際特許分類7:

H01S 3/134

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011434

(22) 国際出願日:

2004年8月9日 (09.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-291463 2003年8月11日(11.08.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ギガ フォトン株式会社 (GIGAPHOTON INC.) [JP/JP]; 〒 1000004 東京都千代田区大手町二丁目 6番 1号 朝日 東海ビル Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 有我 達也 (ARIGA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒2548567 神奈川県平 塚市万田1200株式会社小松製作所 研究所内 Kanagawa (JP). 若林 理 (WAKABAYASHI, Osamu) [JP/JP]; 〒2548567 神奈川県平塚市万田1200 株 式会社小松製作所 研究所内 Kanagawa (JP). 柿崎 弘 司 (KAKIZAKI, Kouji) [JP/JP]; 〒2548567 神奈川県 平塚市万田 1 2 0 0 株式会社小松製作所 研究所内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 木村 高久, 外(KIMURA, Takahisa et al.); 〒 1040043 東京都中央区湊1丁目8番11号千代ビル 6階 Tokyo (JP).

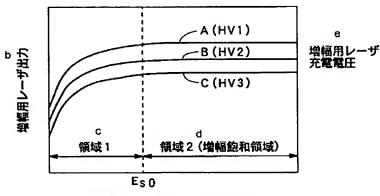
/続葉有/

(54) Title: TWO-STAGE LASER PULSE ENERGY CONTROL DEVICE AND TWO-STAGE LASER SYSTEM

e

(54) 発明の名称: 2ステージレーザのパルスエネルギー制御装置及び2ステージレーザシステム

a 増幅用レーザに注入されるシード光のエネルギーと 増幅後のエネルギーの関係を示す図



f 増幅用レーザ入力に注入される シード光のエネルギー

- a DIAGRAM SHOWING RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY OF SEED LIGHT INTRODUCED TO AMPLIFICATION LASER AND ENERGY AFTER AMPLIFICATION
- **b AMPLIFICATION LASER OUTPUT**
- c REGION 1
- d REGION 2 (AMPLIFICATION SATURATION REGION)
- e AMPLIFICATION LASER CHARGE VOLTAGE
- f ENERGY OF SEED LIGHT INTRODUCED TO AMPLIFICATION LASER INPUT

(57) Abstract: Charge voltage Vosc controlled to be a constant value is supplied to a main capacitor CO arranged in a high -voltage pulse generator (12) for oscillating an oscillation laser (100) so that the pulse energy Posc of the oscillation laser (100) is not smaller than the lower limit energy Es0 of the amplification saturation region. Moreover, by controlling the charge voltage Vamp supplied to the main capacitor CO arranged in a high-voltage pulse generator (32) for amplifying an amplification laser (300), the pulse energy Pamp of the amplification laser (300) is set to a target energy Patgt. Thus, by performing two-stage laser pulse energy control, it is possible to stabilize the pulse energy.

(57) 要約: 発振用レーザ100の パルスエネルギーPoscが増幅飽和 領域の下限エネルギーEsO以上になるように、発振用レーザ100の発 振用高電圧パルス発生器12に設け られた主コンデンサC0への充電電 圧Voscを一定制御する。そして、 増幅用レーザ300の増幅用高電圧 パルス発生器32に設けられた主 コンデンサC0への充電電圧Vamp を制御し、増幅用レーザ300の

パルスエネルギー Pampを目標エネルギー Patgtにする。こうして 2 ステージレーザのパルスエネルギー制御を行い

[続葉有]

WO 2005/015699 A1

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。